

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年6月23日 (23.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/057633 A1

(51) 国際特許分類7: H01L 21/027, G03F 7/16

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017752

(22) 国際出願日: 2004年11月30日 (30.11.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-410105 2003年12月9日 (09.12.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

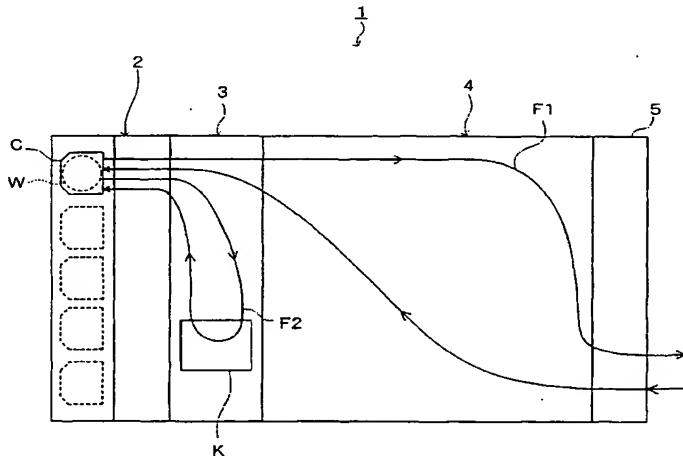
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 篠塚 真一 (SHINOZUKA, Shinichi) [JP/JP]; 〒8611116 熊本県菊池郡合志町福原1-1 東京エレクトロン九州株式会社 合志事業所内 Kumamoto (JP). 和田 栄希 (WADA, Shigeki) [JP/JP]; 〒8611116 熊本県菊池郡合志町福原1-1 東京エレクトロン九州株式会社 合志事業所内 Kumamoto (JP). 山下 刚秀 (YAMASHITA, Masami) [JP/JP]; 〒8691197 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655 東京エレクトロン九州株式会社 熊本事業所内 Kumamoto (JP).

(74) 代理人: 金本 哲男, 外 (KANEMOTO, Tetsuo et al.); 〒1620065 東京都新宿区住吉町1-12 新宿曙橋ビル はづき国際特許事務所 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: SUBSTRATE TREATMENT DEVICE CONTROL METHOD AND SUBSTRATE TREATMENT DEVICE

(54) 発明の名称: 基板処理装置の制御方法及び基板処理装置



(57) Abstract: In a coating/development device having an inspection unit, it is possible to reduce the time required for start, reduce the cost, and improve the operation rate of the inspection unit. In the coating/development device control program, a treatment flow and an inspection flow are set so as to be executed independently of each other. In the treatment flow, a substrate is carried from a cassette station to a treatment station and treated by the treatment station and the exposure device, after which the substrate is returned to the cassette station. In the inspection flow, the substrate is carried from the cassette station to the inspection station and inspected, after which the substrate is returned to the cassette station. When starting the coating/development device, the inspection flow and the treatment flow are executed and simultaneously with this, it is possible to perform evaluation work of an inspection unit of the inspection station and adjustment work of a treatment unit of the treatment station. When the inspection station is empty, it is possible to convey the substrate from outside into the cassette station and inspect the substrate.

(57) 要約: 本発明は、検査部を備えた塗布現像処理装置において、立ち上げ時に要する時間を短縮しコストを低減し、さらに検査部の稼働率を向上することを目的としている。本発明では、塗布現像処理装置の制御プログラムにおいて、基板をカセットステーションから処理ステーションに搬送して処理ステーション及び露光装置において処理し、その後カセットステーションに戻す処理フローと、基板をカセットステーションから検査ステーションに搬送して検査

WO 2005/057633 A1

[続葉有]



(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。